Półprzewodniki

Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT







"Mr. Osborne, may I be excused? My brain is full."

Uniwersytet Warszawski



ENERGIA ELEKTRONÓW

Jak zobaczyć przerwę?

Funkcja rozkładu

Rozkład Fermiego-Diraca



Funkcja rozkładu



Funkcja rozkładu

Rozkład Fermiego-Diraca



Gęstość stanów

Jeśli nasz kryształ ma skończone rozmiary zbiór wektorów k jest skończony (choć olbrzymi!), np. możemy przyjąć periodyczne warunki brzegowe i wtedy:

Warunki Borna-Karmana

Skończone rozmiary kryształu L_x , L_y , L_z

 $\varPsi-$ postać funkcji Blocha

$$\Psi(x+L_x,y,z)=\Psi(x,y+L_y,z)=\Psi(x,y,z+L_z)$$

$e^{ik_xL_x}=1$	
$e^{ik_yL_y}=1$	$\rightarrow 2\pi 4\pi 2\pi n$
$e^{ik_z L_z} = 1$	$k_i = 0, \pm \frac{2\pi}{L_i}, \pm \frac{\pi}{L_i}, \dots, \pm \frac{2\pi}{L_i}$



Stany te wyznaczają w przestrzeni odwrotnej siatkę o gęstości $(V/2\pi)^3$ Gęstość stanów na jednostkę trójwymiarowej przestrzeni k

Gęstość stanów

Jeśli nasz kryształ ma skończone rozmiary zbiór wektorów k jest skończony (choć olbrzymi!), np. możemy przyjąć periodyczne warunki brzegowe i wtedy:



Gęstość stanów

Często wygodniejsza jest znajomość gęstości stanów w przestrzeni energii E (a więc ilość stanów w przedziale (E, E+d E). Dla pasma sferycznego i parabolicznego:



Gęstość stanów

Często wygodniejsza jest znajomość gęstości stanów w przestrzeni energii E (a więc ilość stanów w przedziale (E, E+d E). Dla pasma sferycznego i parabolicznego:



Gęstość stanów

Często wygodniejsza jest znajomość gęstości stanów w przestrzeni energii E (a więc ilość stanów w przedziale (E, E+d E). Dla pasma sferycznego i parabolicznego:



Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?



Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?



Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?



Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?

$$E_{c}(k) = E_{g} + \frac{\hbar^{2}k^{2}}{2m_{c}^{*}} \qquad f_{0} = \frac{1}{e^{\frac{E-E_{F}}{k_{B}T}} + 1} \qquad N_{c}(E) = \frac{1}{2\pi^{2}} \left(\frac{2m_{c}^{*}}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} \sqrt{E-E_{c}}$$

$$E_{h}(k) = -\frac{\hbar^{2}k^{2}}{2m_{h}^{*}} \qquad P_{0} = \frac{1}{e^{\frac{E-E_{F}}{k_{B}T}} + 1} \qquad N_{v}(E) = \frac{1}{2\pi^{2}} \left(\frac{2m_{h}^{*}}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} \sqrt{E_{v}-E_{c}}$$

Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?



Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?

W półprzewodnikach samoistnych w warunkach równowagi termodynamicznej, elektrony w paśmie przewodnictwa pojawiają się wyłącznie wskutek wzbudzenia z pasma walencyjnego.

2

$$n = p = n_i$$

$$n(E_F) = \int_{E_g}^{\infty} f_e N(E) dE = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^2 \int_{E_g}^{\infty} e^{-\frac{(E-E_F)}{k_0 T}} \sqrt{E-E_g} dE$$

$$\int_{0}^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt = \Gamma(z)$$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$$

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$
PrZY tablicy

Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?

W półprzewodnikach samoistnych w warunkach równowagi termodynamicznej, elektrony w paśmie przewodnictwa pojawiają się wyłącznie wskutek wzbudzenia z pasma walencyjnego.

3

$$n = p = n_{i}$$

$$n(E_{F}) = \int_{E_{g}}^{\infty} f_{e} N(E) dE = \frac{1}{2\pi^{2}} \left(\frac{2m_{e}^{*}}{\hbar^{2}}\right)^{\frac{2}{2}} \int_{E_{g}}^{\infty} e^{-\frac{(E-E_{F})}{k_{0}T}} \sqrt{E-E_{g}} dE$$

$$n = 2 \left(\frac{m_{e}^{*}k_{0}T}{2\pi\hbar^{2}}\right)^{\frac{2}{2}} e^{\frac{E_{F}-E_{c}}{k_{B}T}} = N_{c} e^{\frac{E_{F}-E_{c}}{k_{B}T}}$$

$$p = \int_{-\infty}^{E_{v}} f_{h} g_{h} dE$$

$$p = 2 \left(\frac{m_{h}^{*}k_{0}T}{2\pi\hbar^{2}}\right)^{\frac{2}{2}} e^{-\frac{(E_{F}-E_{v})}{k_{B}T}} = N_{v} e^{-\frac{(E_{F}-E_{v})}{k_{B}T}}$$

Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?

W półprzewodnikach samoistnych w warunkach równowagi termodynamicznej, elektrony w paśmie przewodnictwa pojawiają się wyłącznie wskutek wzbudzenia z pasma walencyjnego.

$$n = p = n_{i}$$

$$n \cdot p = n^{2} = 4 \left(\frac{k_{0}T}{2\pi\hbar^{2}}\right)^{3} (m_{e}^{*}m_{h}^{*})^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_{g}}{k_{0}T}} = N_{c}N_{v}e^{-\frac{E_{g}}{k_{0}T}}$$

$$n = p = 2 \left(\frac{k_{0}T}{2\pi\hbar^{2}}\right)^{\frac{3}{2}} (m_{e}^{*}m_{h}^{*})^{\frac{3}{4}} e^{-\frac{E_{g}}{2k_{0}T}} = \sqrt{N_{c}N_{v}}e^{-\frac{E_{g}}{2k_{0}T}}$$

$$e^{-\frac{E_{g}}{2k_{0}T}}$$

1/T

Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?



Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?

W półprzewodnikach samoistnych w warunkach równowagi termodynamicznej, elektrony w paśmie przewodnictwa pojawiają się wyłącznie wskutek wzbudzenia z pasma walencyjnego.

Eg\T	77K	300K	1200K	materiał	
0,25eV	$10^9 {\rm ~cm}^{-3}$	10 ¹⁶ cm ⁻³	10 ¹⁸ cm ⁻³	InSb PbSe	
1eV	-	$10^{10} \mathrm{cm}^{-3}$	10 ¹⁷ cm ⁻³	Ge, Si, GaAs	he wsk
4eV	-	-	10 ¹¹ cm ⁻³	ZnS, SiC, GaN, ZnO, C (diament)	R. Stepi

Koncentracja samoistna typowych półprzewodników

W powyższej tabelce wartości poniżej 10¹⁰ cm⁻³ nie mają sensu gdyż koncentracja zanieczyszczeń, a co za tym idzie koncentracja wynikająca z nieintencjonalnego domieszkowania jest większa

$$n = p = \sqrt{N_c N_v} e^{-\frac{E_g}{2k_0 T}} \qquad n = N_c e^{\frac{(E_F - E_c)}{k_B T}}$$

$$p = N_v e^{-\frac{k_B T}{k_B T}}$$

Jaka jest koncentracja nośników dla T>0?

W półprzewodnikach samoistnych w warunkach równowagi termodynamicznej, elektrony w paśmie przewodnictwa pojawiają się wyłącznie wskutek wzbudzenia z pasma walencyjnego.

Widać że wartość przerwy energetycznej nie jest wystarczającym kryterium na rozróżnienie półprzewodników i izolatorów, np. czysty Ge, Si i GaAs mają w temperaturze pokojowej bardzo niską koncentrację nośników co czyni je materiałami o właściwościach izolatorów.

Lepsze kryterium – dla półprzewodników istnieje możliwość domieszkowania powodującego znaczące zmiany koncentracji i typu przewodnictwa (elektrony lub dziury).

Półprzewodniki



Grupa IV: diament, Si, Ge Grupy III-V: GaAs, AlAs, InSb, InAs... Grupy II-VI: ZnSe, CdTe, ZnO, SdS...

W jaki sposób kontrolować koncentrację nośników?

W półprzewodnikach spotykamy szereg odstępstw od idealnej struktury kryształu:

· defekty struktury kryształu, luki, atomy w położeniu międzywęzłowym, dyslokacje powstałe np. w procesie wzrostu.

· obce atomy (**domieszki**) wprowadzane intencjonalnie lub wskutek zanieczyszczeń (poziom czystości)

Wskutek ich występowania pojawiają się między innymi:

- · stany dozwolone w przerwie wzbronionej na skutek odstępstw od potencjału idealnej sieci
- · ładunki przestrzenne w izolatorach
- · ekranowanie przez swobodne nośniki

Stany domieszkowe dzielimy na:

 · głębokie –potencjał krótkozasięgowy, zlokalizowany głównie w obszarze jednej komórki elementarnej – np. luka, domieszka izoelektronowa (o tej samej wartościowości co macierzysty atom np. N w InP).

· płytkie - głownie potencjał długozasięgowy – kulombowski

Voyles, P. M. et al. Nature 416, 826-829 (2002)



10²² atomów Si 10¹⁷ domieszek Rozmiar tranzystora 50 nm Średnia ilość domieszek 12.5

State-of-the-art TEM image of ultrathinned (5 nm) sample.

PROBLEM: Statystyka domieszek

Voyles, P. M. et al. Nature 416, 826-829 (2002)



10²² atomów Si 10¹⁷ domieszek Rozmiar tranzystora 50 nm Średnia ilość domieszek 12.5

State-of-the-art TEM image of ultrathinned (5 nm) sample.

PROBLEM: Statystyka domieszek

Voyles, P. M. et al. Nature 416, 826-829 (2002)



10²² atomów Si 10¹⁷ domieszek Rozmiar tranzystora 50 nm Średnia ilość domieszek 12.5

State-of-the-art TEM image of ultrathinned (5 nm) sample.





GaN na szafirze (0001) - widoczna symetria heksagonalna

c306.006



GaN na szafirze (0001) - dyslokacje: śrubowa (S), krawędziowa (E)

i mieszana (M) - przykłady

EFM – Electric Force Microscopy



Siła elektryczna (gradient) ⇔ zmiana częstości rezonansowej Pętla sprzężenia zwrotnego: utrzymanie rezonansu

GaN polarność galowa - "pinholes" i domeny inwersyjne



0

Model wodoropodobny

Atom o wartościowości wyższej o jeden niż atom macierzysty staje się źródłem potencjału kulombowskigo zmodyfikowanego stałą dielektryczną kryształu, wywołanego dodatkowym protonem w jądrze. Dodatkowy elektron będący w paśmie przewodnictwa odczuwa ten potencjał. Jego stany są opisane równaniem masy efektywnej:

$$T = -\frac{\hbar^2}{2m^*}\Delta \qquad U = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{\varepsilon r}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e^*}\Delta - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{\varepsilon r}\right]\phi(r) = E\phi(r)$$

II		IV	V	VI
Be	В	С	Ν	0
Mg	AI	Si	Ρ	S
Zn	Ga	Ge	As	Se
Cd	In	Sn	Sb	Те

Grupa IV: diament, Si, Ge Grupy III-V: GaAs, AlAs, InSb, InAs... Grupy II-VI: ZnSe, CdTe, ZnO, SdS...

Model wodoropodobny

Ostatecznie zagadnienie sprowadza się do problemu atomu wodoru z nośnikiem swobodnym o masie m*, w ośrodku dielektrycznym ze stałą ε i małą "poprawką" do potencjału.

$$E_n = -\left(\frac{m^*}{m_0}\right) \frac{13.6eV}{\varepsilon^2 n^2}$$

Dla typowych półprzewodników $m_e^* \approx 0.1 m_e$ $\varepsilon_s \approx 10$, zatem energia wiązania dla stanu podstawowego jest rzędu kilkudziesięciu meV. Promień Bohra dla stanu podstawowego jest rzędu 100Å:

$$r_B^* = -\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_0e^2}\varepsilon_s\left(\frac{m_0}{m_e^*}\right) \approx 0.5 \stackrel{\circ}{\mathrm{A}}\varepsilon_s\left(\frac{m_0}{m_e^*}\right)$$

II		IV	V	VI
Be	В	С	Ν	0
Mg	AI	Si	Ρ	S
Zn	Ga	Ge	As	Se
Cd	In	Sn	Sb	Те

Grupa IV: diament, Si, Ge **Grupy III-V:** GaAs, AlAs, InSb, InAs... **Grupy II-VI:** ZnSe, CdTe, ZnO, SdS...

Neutralny donor

Magneto-spektroskopia w silnych polach magnetycznych





m*

Andrzej Wysmołek

Spektroskopia w dalekiej podczerwieni







 E_B =30.28meV

∆g=0.3(1)

p=2.3(1)

 $\Delta E_p = 1.3(1) \text{ meV}$

Andrzej Wysmołek


Andrzej Wysmołek

Elektrony i dziury

Przerwa energetyczna

Wyznaczanie przerwy energetycznej:



Model wodoropodobny

Ostatecznie zagadnienie sprowadza się do problemu atomu wodoru z nośnikiem swobodnym o masie m*, w ośrodku dielektrycznym ze stałą ε i małą "poprawką" do potencjału.

$$E_n = -\left(\frac{m^*}{m_0}\right) \frac{13.6eV}{\varepsilon^2 n^2}$$

Dla typowych półprzewodników $m_e^* \approx 0.1 m_e$ $\varepsilon_s \approx 10$, zatem energia wiązania dla stanu podstawowego jest rzędu meV.

Promień Bohra dla stanu podstawowego jest rzędu 100Å:

$$r_B^* = -\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_0e^2}\varepsilon_s\left(\frac{m_0}{m_e^*}\right) \approx 0.5 \stackrel{\circ}{\mathrm{A}}\varepsilon_s\left(\frac{m_0}{m_e^*}\right)$$

II		IV	V	VI
Be	В	С	N	0
Mg	AI	Si	Ρ	S
Zn	Ga	Ge	As	Se
Cd	In	Sn	Sb	Те

Grupa IV: diament, Si, Ge Grupy III-V: GaAs, AlAs, InSb, InAs... Grupy II-VI: ZnSe, CdTe, ZnO, SdS...



Jak zobaczyć przerwę?

Model wodoropodobny

jonizacja domieszki



Domieszkowanie





Koncentracja nośników w półprzewodniku niesamoistnym

Rozważmy półprzewodnik, w którym:

- N_A koncentracja akceptorów
- N_D koncentracja donorów
- $p_{\boldsymbol{A}}$ koncentracja neutralnych akceptorów
- n_D koncentracja neutralnych donorów
- n_c koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa
- p_v koncentracja dziur w paśmie walencyjnym
- Z warunku neutralności kryształu:

Przy tablicy!

Domieszkowanie





Koncentracja nośników w półprzewodniku niesamoistnym

Rozważmy półprzewodnik, w którym:

- N_A koncentracja akceptorów
- N_D koncentracja donorów
- $p_{\boldsymbol{A}}$ koncentracja neutralnych akceptorów
- n_D koncentracja neutralnych donorów
- n_c koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa
- p_v koncentracja dziur w paśmie walencyjnym

Z warunku neutralności kryształu:

$$n_{c} + (N_{A} - p_{A}) = p_{v} + (N_{D} - n_{D})$$
$$n_{c} + n_{D} = (N_{D} - N_{A}) + p_{v} + p_{A}$$

Domieszkowanie





Koncentracja nośników w półprzewodniku niesamoistnym

Rozważmy półprzewodnik, w którym:

- N_A koncentracja akceptorów
- N_D koncentracja donorów
- $p_{\boldsymbol{A}}$ koncentracja neutralnych akceptorów
- n_D koncentracja neutralnych donorów
- n_c koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa
- p_v koncentracja dziur w paśmie walencyjnym

Z warunku neutralności kryształu:



Domieszkowanie



Teoria pasmowa ciał stałych.







półprzewodnik typu p

półprzewodnik typu n

Teoria pasmowa ciał stałych.

Dioda – czyli złącze p-n



typ p typ n

Flat band

Półprzewodniki zdegenerowane

- Pasmo domieszkowe.
- Przejście Motta

$$N_D \ge \left(\frac{1}{a_B^*}\right)^3$$





Nevill Francis Mott



ENERGIA ELEKTRONÓW

Jak zobaczyć przerwę?

Przerwa energetyczna



Fig. 11.4. Room-temperature bandgap energy versus lattice constant of common elemental and binary compound semiconductors.

Wymiary świata



3D: Kryształ objętościowy



1D: Drut kwantowy



2D: Studnia kwantowa



Elektron w kropce kwantowej jest związany w trzech wymiarach (jak w atomie)

0D: Kropka kwantowa

Turid Worren NTNU Norway

Top-down, czyli małe jest piękne!



Nanotechnologia Litografia Udoskonalenia Galeria Fizyka na Hożej



Uniwersytet Warszawski



Urodzony w 1885 roku jako ósmy syn ubogiego stolarza. Nie jest pewne czy zdał maturę. Nie stać go było na opłacenie studiów. Odkrywca metody wzrostu kryształów - *"metody Czochralskiego"*. Uznawany za *"praojca elektroniki"* Polski uczony **najczęściej wymieniany w literaturze światowej**. W Polsce prawie nieznany...



http://www.ptwk.org.pl/pol/patron.html



STANOWISKO SENACKIEJ KOMISJI HISTORII I TRADYCJI SZKOŁY PW W SPRAWIE UCHWAŁY SENATU Z DNIA 19 GRUDNIA 1945 R. DOTYCZĄCEJ PROF. DR. H.C. JANA CZOCHRALSKIEGO

Jak wynika z zeznań świadków, w tym mgr. inż. Ludwika Szenderowskiego, b. kierownika warsztatu i odlewni w Zakładzie Badań Materiałów, a jednocześnie członka ruchu oporu, w r. 1942 na terenie ZBM rozpoczęła swą potajemną działalność komórka organizacyjna AK w zakresie produkcji odlewów żeliwnych skorup do granatów, elementów drukarń polowych i części do pistoletów. Prof. Czochralski wiedział o tym i nie tylko tolerował, ale i ochraniał działalność konspiracyjną w swym zakładzie wobec władz niemieckich i gestapo.

Na korzyść prof. Czochralskiego należy również zaliczyć jego działalność poza ZBM. Wykorzystując swe rozległe znajomości, interweniował wielokrotnie i dość skutecznie u władz okupacyjnych w celu uwolnienia różnych osób z obozów niemieckich, więzień i obozów koncentracyjnych. Wśród osób uwolnionych można znaleźć m.in. nazwisko dr. Mariana Świderka, późniejszego profesora PW, wnuka Ludwika Solskiego.

Znamienna jest tu wypowiedź b. asystentki prof. Czochralskiego prof. dr Zofii Wendorff, że "nie zna ona przypadku, aby prof. Czochralski odmówił pomocy Polakom, którzy się do niego zwrócili".

Metoda Cz



http://www.ptwk.org.pl/pol/patron.html

Uzasadnienie Sądu i decyzja o zwolnieniu z zarzutów, Łódź , dnia 13.sierpnia 1945r

Uzasadnienie

Jan Czochralski, Mieczysźaw Wojciechowski i Leonia z Czochralskich Wojciechowska podejrzani są o wspóźpracę z niemieckimi wźadzami okupacyjnymi na szkodę osób spośród ludności cywilnej względnie Państwa Polskiego.

W toku przeprowadzonego dochodzenia ustalono, że Jan Czochralski przybyź do kraju w roku 1928 r. z Niemiec na wezwanie wźadz państwowych, jako fachowiec w dziedzinie metalurgii i otrzymaź katedrę metalurgii na Politechnice Warszawskiej. Następnie zostaźo mu również powierzone kierownictwo Instytutu Metalurgii i Metaloznaštwa w Warszawie /k.32/.

Wskutek dziaźań wojennych we wrześniu 1939 r. Instytut ten zawiesiź swą pracę. Na początku 1940 r. Instytut, za zezwoleniem niemieckich wźadz okupacyjnych wznowiź swą pracę, lecz już jako przedsiębiorstwo przemysźowo-handlowe /k.8,33-34,43,46,58/. Między innymi przedsiębiorstwo to produkoważo panewki i tżoki dla wojskowych reperacyjnych warsztatów samochodowych. W związku z tym Czochralski wszedź w kontakt z niemieckimi wżadzami okupacyjnymi, co byżo niewątpliwie asumptem do przypusaczeń, że Czochralski uprawia dziażalność, szkodliwę dla Państwa Polskiego względnie osób spośród ludności cywilnej. Jednakże materiaź zebrany w dochodzeniu nie potwierdziź tych przypuszczeń. Przeciwnie z akt dochodzenia wynika, że dzięki stosunkom Czochralskiego udażo się wydostać szereg osób z obozów koncentracyjnych względnie więzień /k.25,35,36,39,46,58/.

Dochodzenie nie dostarczyżo również żadnych konkretnych faktów szkodliwej dziażalności zejs trony innych czżonków rodziny Jana Czochralskiego, a w szczególności ze strony Miedzysżawa i Leonii Wojciechowskich. Zaznaczyć przy tym należy, że Leonia Wojciechowska w szeregu wypadków skutecznie interwenioważa u wżadz niemieckich na rzecz osób, aresztowanych przez wżadze okupacyjne /k.12,13,15,19-23/.

W świetle tych ustaleń brak jest podstaw do ścigania Jana Czochralskiego oraz Mieczysźawa i Leonii Wojciechowskich przed Specjalnym Sądem Karnym w kierunku jednego z przestępstw, przewidzianych w dekrecie P.K.W. N. z dnia 31.8.1944 r. w brzmieniu dekretu z dnia 16.2.1945 r./Dz.U.R.P. Nr.7/45, poz.29/.

Postanawiam zgodnie z wnioskiem Wiceprokuratora rejonowego.

Postanowienie

Odnotowano S Prokutator

Zodž, dnia 13 sierpnia 1945 r.





http://www.sehmy.com/Product/abtWafers.htm









© "Smithsonian", Jan 2000, Vol 30, No. 10

Struktury niskowymiarowe Low-dimensional Semiconductor Systems



Hubert J. Krenner

Struktury niskowymiarowe Low-dimensional Semiconductor Systems



MBE



Studnia kwantowa





MBE→ Osadzanie z atomową precyzją warstw o różnym składzie lub domieszkowaniu



























Studnie Kwantowe

Lasery półprzewodnikowe



Inżynieria przerwy energetycznej









QCL - Quantum Cascade Laser



QCL - Quantum Cascade Laser









The QUANTA® OEM module (LASER COMPONENTS)

http://www.sacher-laser.com/QCL_LaserHead.php
QCL - Quantum Cascade Laser







The QUANTA® OEM module (LASER COMPONENTS)

http://www.sacher-laser.com/QCL_LaserHead.php

Band structure engineering



Hubert J. Krenner

Studnie Kwantowe

Więcej: http://britneyspears.ac/lasers.htm







Struktury niskowymiarowe Low-dimensional Semiconductor Systems



Druty

Figure 9 Quantum wire fabrication based on nanoscale etching and re-growth



Figure 11 Growth of quantum wires on a vicinal surface with multiatomic steps







Fig. 3) Growth contains three components: **T** Beside diffusion trough the droplet (I) and diffusion on the droplet surface (II), there is a strong surface diffusion componet (III) along the whisker. Si material is coming from the surrounding of the whisker.

http://www.mpi-halle.mpg.de/~mbe/



www.ece.odu.edu/g_seminar.htm



Photo by Peidong Yang/UC Berkeley, courtesy of Science

Struktury niskowymiarowe Low-dimensional Semiconductor Systems





Hubert J. Krenner

Walter Schottky Institut and Physik Department E24, TU München

Wzrost kropek kwantowych



GaN/AIGaN QD's



c585.000

Wzrost – K. Pakuła, AFM - Rafał Bożek







GaN/AIGaN QD's



 μPL - Katarzyna Surowiecka et al.



Trendy – prawo Moore'a: scalaki

Uniwersytet Warszawski

Trochę historii







1948 – William Schockley, John Bardeen oraz Walter Brattain z Bell Labs wymyślają tranzystor (Nobel 1956)



Źródło: http://www.facsnet.org/tools/sci_tech/tech/applications/chipsys.php3 http://www.lucent.com/minds/transistor/history.html, http://www.pbs.org/transistor/science/events/pointctrans.html

Jak działa tranzystor?





Prof. Juliusz Edgar Lilienfeld 1925 tranzystor polowy Cu₂S (Lipsk)

http://www.pbs.org/transistor/science/events/pointctrans.html

Jak działa tranzystor?

18.04.1881, (Lemberg)- 8.08.1963, (Charlotte Amalie, U.S.A.)







U.S. Patent 1,745,175 (MESFET) U.S. Patent 1,900,018 (MOSFET)

Prof. Juliusz Edgar Lilienfeld 1925 tranzystor polowy Cu₂S (Lipsk)

http://www.computerhistory.org/semiconductor/timeline/1926-field.html

Jak działa tranzystor?







http://chem.ch.huji.ac.il/history/lilienfeld.htm

Trochę historii

1955 Shockley Semiconductor – pierwsza firma w Palo Alto (krzemowej dolinie)

Rok 1956

IBM tworzy pierwszy dysk twardy - RAMAC 350. Jego pojemność to 5MB,natomiast cena - milion dolarów. W laboratoriach MIT ukończony zostaje pierwszy komputer tranzystorowy.

A. Newell, D. Shaw i F. Simon wynajdują IPL (Information Processing Language - język przetwarzania informacji).

1957 Fairchild Semiconductor – na skutek nieporozumień z Shockleyem odchodzą z firmy: Julius Blank, Victor Grinich, Gordon E. Moore, Robert W. Noyce, Jean Hoerni, Gene Kleiner, Jay Last, Sheldon Roberts **("zdradziecka 8-ka").**



Ken Olsen i Harlan Anderson zakładają firmę DEC (Digital Equipment Corporation).

Oficjalnie opublikowany zostaje język FORTRAN-1, stworzony przez Johna Backusa i jego współpracowników z IBM. FORTRAN używa zapisu podobnego do tego z algebry. Dlatego też język ten stanie się popularny, szczególnie wśród naukowców i techników.

1958 Pierwszy układ scalony (IC – Integrated Circuit) wykonany przez Jack Kilby na germanie w **Texas Instruments** (2000 Nagroda Nobla z fizyki). Niezależnie Robert Noyce (**Fairchild**) zbudował IC na krzemie.

Prawo Moore'a

"The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year. Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will remain nearly constant for at least 10 years." (Moore, *Electronics* 1965)



Źródło: Wikipedia, Intel, http://www.pldos.pl/bogus/hardware/procesory/intel/i4004/i4004.htm

18 lipca **1968** Gordon E. Moore i Robert W. Noyce założyli w kalifornijskim Mountain View w hrabstwie Santa

18 lipca **1968** Gordon E. Moore i Robert W. Noyce założyli w kalifornijskim Mountain View w hrabstwie Santa Clara (zaledwie kilka mil od Palo Alto), firmę N M Electronics, wkrótce przemianowaną na Intel (Intel = Integrated Electronics).

1969 r. Intel Corporation dostaje zamówienie na układ do japońskiego kalkulatora...





i4004

Data wprowac Ilość tranzystc Technologia:1 Wielkość płytk Szybkość prac (0.06 MIPS) Taktowanie ma Szerokość ma (adresów 12 b

i8008

Data wprowadzenia:kwiecień 1972

llość tranzystorów:3 500

Technologia:10 µm, PMOS

Wielkość płytki krzemu:19 mm²

Szybkość pracy Taktowanie rdzenia proc.:200 kHz (0.06 MIPS), magistrali sys.:200 kHz

Szerokość magistrali danych (wewn./zewn.):**8 bitów** Szerokość magistrali adresowej:14 bitów





Trochę historii





1975 Altair (i jego klony)

procesor Intel 8080 Bill Gates i Paul Allen piszą wersję BASICa na Altair

A gdzie jest ekran i klawiatura?





Pentium 4 (2000)

42 000 000 tranzystorów technologia 0.18 mikrona. Zegar 1.5 GHz 6 warstw

Rozmiar procesorów Intel (w skali)



Źródło: Intel, http://www.facsnet.org/tools/sci_tech/tech/fundaments/mooreslaw.php3

TRENDY: Pierwsze Prawo Moore'a

🕲 Intel - granica 1 mld tranzystorów przekroczona - Mozilla Firefox						
<u>P</u> lik <u>E</u> dycja <u>W</u> idok	Przej <u>d</u> ź <u>Z</u> akładki <u>N</u> arzędz	:ia Pomo <u>c</u>				୍ 😔 🔿
🔷 • 🔷 • 🔗	区 😭 🏢 http://gosp	odarka.gazeta.pl/gospc	odarka/1,60070,2973049.htm	· · · O	Idź ⊘	
🥐 Rozpocznij przygodę 🗁 Aktualności 啷 Słownik Ang. 🐽 Słownik Fra. 🏧 Langue française le 🇱 GW: Wiadomości 🧏 INTERIA.PL - Fakty 🔷						
🗰 gazeta.pl 🛛 Blogi Forum Poczta Randki + Ogłoszenia Aaaby.pl 🖥 Gazeta Wyborcza 🥻						
gospodarka ::: gazeta.pl						
Gospodarka	Firma	Giełda	Waluty	Pieniądze	Centrum Finans	sowe
Gospodarka	Gazeta.pl > Gospodarka > 1	IDG .		Wto	rek , 18 października	a 2005
Wiadomości Technologie media				<u> </u>	[SZUKAJ
internet Opinie i analizy	Intel - granica 1 mld tranzystorów przekroczona					
Depesze ISB Puls Biznesu	NetWorld 18-10-2005 , ostatnia aktualizacja					
Wywiady radia PiN BiznesNet Modern Marketing Wydawnictwa IDG Brief	Intel zaczął dostarczać wybranym klientom pierwsze dwurdzeniowe układy Itanium 2 noszące nazwę kodową Montecito, które zawierają ponad miliard tranzystorów. Oznacza to, że jesteśmy świadkami przekroczenia kolejnego progu w dziedzinie technologii produkcji układów scalonych.					
Inwestor Finansowy e-biznes Fundusze	Intel zapowiadał już w 2002 roku, że pracuje nad układem CPU zawierającym ponad miliard tranzystorów. Warto przypomnieć, że układ Itanium 2 noszący nazwę kodową Madison zawiera 500 mln tranzystorów.					
Europejskie CIRE Komunikaty firm Komunikaty banków	Kolejną ważną cechą układu Montecito jest to, że każdy rdzeń dysponuje swoim własnym buforem na dane. Dlatego układ ma duże rozmiary (ok. 580 milimetrów kwadratowych). Układy Itanium drugiej generacji, produkowane w 2002 roku, miały powierzchnię 400 do 450 milimetrów kwadratowych.					
News in English powered by Warsaw Business Journal	Intel zwiększał przez ostanie 20 lat sukcesywnie liczbę tranzystorów zagnieżdżanych na układach scalonych. Układ 386, którego produkcję uruchomiono w 1985 roku, miał 275 tys. Tranzystorów. Liczna jednego miliona tranzystorów została przekroczona w 1989 roku, z chwila podjecja produkcji układu 486					
Branże: Banki, ubezpieczenia Browary i piwo Budownictwo Handal	Kolejne rekordy padły w 1993 roku (układ Pentium; trzy mln tranzystorów) i następnie w 2002 roku (Pentium 4,42 mln tranzystorów). Pierwszy układ Itanium 2 (2002 rok) zawierał 220 mln tranzystorów.					
Paliwa	Janusz Chustecki					

Intel

Core i7-9xx Extreme Edition (2009)

800 000 000 tranzystorów, 2, 4, 8 rdzeni

technologia 45 nm – 32 nm

Zegar max 3,33 GHz

9 warstw

Moc ok. 65 W





AMD Athlon II X2 B24 (2009)

450 000 000 tranzystorów; 2,3,4 rdzenie technologia 45 nm. Zegar max 2,8 – 3,1 GHz

11 warstw

Moc 65 W -140 W















TRENDY: Pierwsze Prawo Moore'a

1G

100M

10M

1M

100k

10k

1k

100

1970

۵

Transistors

Ilość komponentów (tranzystory, połączenia, izolacje itd.) w IC podwaja się co około 18 miesięcy.

Rozmiar liniowy komponentów również zmniejsza się wykładniczo w czasie.



Te trendy nie mogą być kontynuowane w nieskończoność.

1990

Year

1980

- Co zastąpi technologię Si?
- Z czego będzie wynikała ta zmiana technologii?

EKONOMIA

human human human human human j

2000



Koszt pojedynczego komponentu maleje wykładniczo o ok. 35% na rok. ALE: Koszt fabryki produkującej chipy rośnie także wykładniczo! W 2025 roku fabryka procesorów kosztowałaby 1 bilion USD (10¹² USD)

Ten trend w oczywisty sposób również nie może być kontynuowany!

PROBLEM (?): Zjawiska kwantowe



- History and future projections for minimum feature size in silicon chips.
- Device limits appear today to be ≈ 25 nm (250 Å) channel lengths in MOS transistors.

Źródło: Intel, Sematech

NO EXPONENTIAL IS FOREVER...

BUT WE CAN DELAY "FOREVER"

Gordon Moore, 2003

Granice miniaturyzacji?



25 nm MOSFET Produkcja od 2008



Produkcja ???

Asen Asenov, Glasgow David Williams *Hitachi-Cambridge* IEEE Trans Electron Dev 50(9), 1837 (2003)

PROBLEM: Tunelowanie


PROBLEM: Tunelowanie



PROBLEM: Chłodzenie

Z roku na rok układy wymagają większej mocy do wykonywania operacji logicznych.



PROBLEM: Chłodzenie

Gęstość mocy rośnie dramatycznie.

10⁷ tranzystorów pracujących z częstością 1.5 GHz zużywa 130 W. Zakładając, że na tej samej powierzchni za jakiś czas będzie pracować 10⁸ tranzystorów z częstością 10 GHz otrzymamy gęstość mocy na poziomie 10 kW/cm² (porównywalną gęstość mocy ma silnik rakietowy!)

<u>Film</u>



International Technology Roadmap for Semicond.





SEMATECH: międzynarodowe konsorcjum producentów półprzewodników – określa cele, opłaca badania nad rozwiązaniem problemów dotyczących "wszystkich", w jego skład wchodzą: AMD, Agere Systems, Hewlett-Packard, Hynix, Infineon Technologies, IBM, Intel, Motorola, Philips, STMicroelectronics, Texas Instruments

Stara się zdefiniować "wyzwania technologiczne", określić dalsze cele i przewidzieć ich specyfikację, koszt, wydajność, czas wdrożenia itp.



Źródło: Intel, Sematech

PROBLEM: Podłoża

Krzem 2003,

- wafer 30 mm:
- Wymagane jest nie więcej niż 120 cząstek <100 nm na wafer</p>
- Dokładność polerowania 130 nm

Krzem 2007,

- wafer 30 mm:
- Wymagane jest nie więcej niż 77 cząstek <100 nm na wafer (jak to zmierzyć?)
- Dokładność polerowania 65 nm

Krzem 2016,

- wafer 450 mm:
- Wymagane jest nie więcej niż 77 cząstek <100 nm na wafer (jak to zmierzyć?)
- Dokładność polerowania 22 nm (jak to zmierzyć?)

PROBLEM: Litografia



PROBLEM: Litografia

Litografia 2003,

- Długość fali światła 248 nm
- Kanał FET 90 nm:
- Wymagane jest nie więcej niż 2000/m2 <100 nm</p>
- Fluktuacje granic rezystu 7 nm

Litografia 2007,

- Długość fali światła 193 nm (?) 153 nm (?) X-ray (?)
- Kanał FET 35 nm:
- Wymagane jest nie więcej niż 1500/m2 <100 nm
- Fluktuacje granic rezystu 3 nm

Litografia 2016,

- Długość fali światła X-ray (?)
- Kanał FET 9 nm:
- Wymagane jest nie więcej niż 500/m2 <100 nm
- Fluktuacje granic rezystu 1 nm

Prawdopodobnie koniec epoki polimerowych rezystów (cząstki polimerów są zbyt duże!)



Trendy – prawo Moore'a: scalaki

Uniwersytet Warszawski



Nanotechnologia











Seagate 60GB 1.8-inch Hard Drive







Hitachi 1.0-inch 6GB Micro Drive

Toshiba 60GB 1.8-inch Hard Drive





2009

Industrial Pq1°

EULEOT 2.5" SATA Solid State Disk 256GB

Windows CE.net







HTC Desire Z

2011







1TB

Ö

IN STREET BEFORE



Mo

Technologie Wymiatające



umożliwi przegranie muzyki na komputer.

Technologie Wymiatające

3

Pierwszy komputer wszczepiany w oko - Oczy - Zdrowie i	w Dziennik.pl - Dziennik.pl - wiadomości, informacje, rozrywka	- Mozilla Firefox		x
< <u>E</u> dycja <u>W</u> idok <u>H</u> istoria <u>Z</u> akładki <u>N</u> arzędzia Pom	<u>2</u> 0			
Service X 🚯 📽 🔇 http://zdrov	vie.dziennik.pl/oczy/artykuly/324702,pierwszy-komputer-w 🔝 🕯	☆ 🔹 🚼 ▾ Google	# ٩	ABP-
🦻 Pierwszy komputer wszczepiany w o 🛛 🕂				-
IFOR.PL gazetaprawna.pl forsal.pl totalmoney.pl (dziennikinternautow.pl infooko.pl	1	m mdziennik.pl 🧧	DGF
	Niedziela, 6 marca 2011 Imieniny: J	ordana, Róży, Kolety Po	ogoda: Warszawa Da	ziś 粒
dziennik pl ocz	Y	Dziennik Foru	um Pf.pl	
Jasze serwisy: Wiadomości Gospodarka Opinie	Auto Kobieta Rozrywka Film Muzyka Nauka	a Nieruchomości P	odróże Zdrowie	Pog
Zdrowie Aktualności Diety Grypa	a Cukrzyca Alergie Profilaktyka S	Senior Oczy	Nowotwory	Fo
Pierwszy komputer w	szczepiany 🗚 🗛 🖉 🗣 🛛	Dziennik.pl po	oleca	
Pierwszy komputer w w oko 2011-03-04 Ostatnia aktualizacja: 12:21 Komentarze: 1	Tagi: badania, jaskra, naukowcy, oko Tagi: badania, jaskra, naukowcy, oko Naukowcy amerykańscy skonstruowali komputer o wielkości jednego milimetra sześciennego. Będzie on wszczepiany do oka chorym na ostrą postać jaskry. Ma monitorować ciśnienie śródgałkowe - poinformował magazyn naukowy Technology	Dziennik.pl po Wałęsa wie, kiedy Smoleńsk przesta dzielić Polaków	oleca Dieca Czołgi ataku "Niszczą ws napotkają"	ują. szystł
Pierwszy komputer w w oko 2011-03-04 Ostatnia aktualizacja: 12:21 Komentarze: 1	AAA IN INTERNI SZCZEDIAN AAA INTERNI Tagi: badania, jaskra, naukowcy, oko Naukowcy amerykańscy skonstruowali komputer o wielkości jednego milimetra sześciennego. Będzie on wszczepiany do oka chorym na ostrą postać jaskry. Ma monitorować ciśnienie śródgałkowe - poinformował magazyn naukowy Technology Review. Rekomenduj artykuł Dodaj do: INTERNIC INTERNICTION INTERNICTION INTERNICTION INTERNICTION INTERNICTION INTERNICTION INTERNICTION INTERNICI INTERNICI INTERNICI INTERNICI INTERNICI INTERNICI INTERNICI IN	Dziennik.pl po Wałęsa wie, kiedy Smoleńsk przestał dzielić Polaków Najnowsze Zu 11:36 Cukrzyca wiąże 12:14 Pierwszy komo	oleca Deca Czołgi ataku "Niszczą ws napotkają" drowie 5º Epidemia chorobliwej otyłości. Ws młodych! e się z nowotworam puter wszczeniany w	j śród

Zakończono

WYDZIAŁ FIZYK,

UNIWERSYTET WARSZAWSK



Technologie Wymiatające

In a package that's just over 1 cubic millimeter, the system fits an ultra low-power microprocessor, a pressure sensor, memory, a thinfilm battery, a solar cell and a wireless radio with an antenna that can transmit data to an external reader device that would be held near the eye.



University of Michigan

CCD



1/2

Willard S. Boyle and George E. Smith

Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, USA

"for the invention of an imaging semiconductor circuit – the CCD

sensor"





Photo: U. Montan

Willard S. Boyle

9 1/4 of the prize

Bell Laboratories Murray Hill, NJ, USA



b. 1924 (in Amherst, NS, Canada)



Photo: U. Montan

George E. Smith

9 1/4 of the prize

Bell Laboratories Murray Hill, NJ, USA

b. 1930

CCD



1/2 Willord S

Willard S. Boyle and George E. Smith

Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, USA

"for the invention of an imaging semiconductor circuit – the CCD sensor"



OmniVision Readies for Wafer Level Camera Cube Production





evolution of the mobile phone camera



2002





Trendy – prawo Moore'a: THz

Uniwersytet Warszawski



Badania na Hożej

Dr Jerzy Łusakowski, Dr Krzysztof Karpierz, Mgr Maciej Sakowicz, Prof. dr hab Marian Grynberg



GaAs

Principe de l'imagerie THz











C.P.N.O.H.G

Exemple d'imagerie



P.Mounaix

AS CNRS, 20 Novembre 2003



Fig. 11. Raster-scan imaging in transmission mode of a metallic paper clip. Left: without envelope, right: in envelope. 20 mm x 10 mm THz image was made with a numerical aperture of 0.5 and 0.3 mm pixel size (after Ref. 48).



J Infrared Milli Terahz Waves (2009) 30:1319–1337 DOI 10.1007/s10762-009-9564-9

Field Effect Transistors for Terahertz Detection: Physics and First Imaging Applications

Wojciech Knap • Mikhail Dyakonov • Dominique Coquillat • Frederic Teppe • Nina Dyakonova • Jerzy Łusakowski • Krzysztof Karpierz • Maciej Sakowicz • Gintaras Valusis • Dalius Seliuta • Irmantas Kasalynas • Abdelouahad El Fatimy • Y. M. Meziani • Taiichi Otsuji

Fig. 10. b) The THz image of a metallic cross at 1.63 THz concealed in a paper envelope. Inset shows a photo of the cross for comparison. Scales are in millimeters, linear intensity scale is given in relative units.













Badania na Hożej



Fig. 5 Application of a sub-THz technology for hidden weapon detection (from [4])



Fig. 3. Imaging skin cancer [3]. Courtesy of TeraView, Ltd.



Fig. 4. THz images of a fresh leaf and the same leaf after 48 hours. Courtesy of TeraView, Ltd.

Terahertz technology: devices and applications

Michael Shur

Proceedings of ESSCIRC, Grenoble, France, 2005

Agriculture and Food Industry



Water contents of plants



Wojciech Knap, CNRS

Chemical imaging



Codeine Cocaine Sucrose

Wojciech Knap, CNRS

Narita – Japan Airport



Drug inspection in mails

Wojciech Knap, CNRS





Trendy – prawo Moore'a: RFID

Uniwersytet Warszawski



ABLATION



Hitachi's new RFID chips (pictured on right, next to a human hair) are 64 times smaller than their mu-chips (left)



LibBest Library RFID Management System



http://www.rfid-library.com/





Niebieska elektronika

Uniwersytet Warszawski

Biel, Biel i jeszcze raz biel!













Urządzenia kwantowe

Uniwersytet Warszawski
Quantum Computer I (QC)

Diwave

The Quantum Computing Company[™]

- 1. Bity, P-bity, Q-bity
- 2. Bramki Qbitowe
- 3. Kwantowe procedury
- 4. Poważny problem
- 5. Jak zbudować taki komputer?



Copyright ③ 1997 United Feature Syndicate, Inc. Redistribution in whole or in part prohibited

Za 2 tygodnie

Quantum Computer I (QC)

- 1. Bity, P-bity, Q-bity
- 2. Bramki Qbitowe
- 3. Kwantowe procedury
- 4. Poważny problem

www.unitedmedia.com

5. Jak zbudować taki komputer?

Zgodnie z teorią chaosu

twoja niewielka zamiana

w innym wszechświecie

nie, prawdopodobnie

zabijając wszystkich

mieszkańców

zmieni jego przeznacze-

Wymyśliłem komputer kwantowy mogący oddziaływać z materią z innych wszechświatów by rozwiązać skomplikowane równania



Copyright 3 1997 United Feature Syndicate, Inc. Redistribution in whole or in part prohibited





Kwantowa teleportacja









Maszyna do teleportacji





Fotonika

Uniwersytet Warszawski

Biologiczne kryształy fotoniczne



http://www.mfa.kfki.hu/int/nano/online/2002_butterfly/





Biologiczne kryształy fotoniczne



http://www.mfa.kfki.hu/int/nano/online/2002_butterfly/



Magnetic photonic crystals

P Photonic Crystals

DOI: 10.1002/anie.200701992

Highly Tunable Superparamagnetic Colloidal Photonic Crystals**

Jianping Ge, Yongxing Hu, and Yadong Yin*



Magnetic photonic crystals

P Photonic Crystals

DOI: 10.1002/anie.200701992

Highly Tunable Superparamagnetic Colloidal Photonic Crystals**

Jianping Ge, Yongxing Hu, and Yadong Yin*







Figure 3. Reversible optical responses of 93-nm Fe₃O₄ colloidal photonic crystals to varying external magnetic field. Diffraction peaks blueshift (a) as the magnet-sample distance decreases from 3.1 to 1.8 cm, and red shift (b) as the distance increases from 1.8 to 3.1 cm in step sizes of 0.1 cm in both cases.

Podsumowanie



Uniwersytet Warszawski

Fizyka Materii Skondensowanej

Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl Konrad.Dziatkowski@fuw.edu.pl

http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/FM

S



Uniwersytet Warszawski

Świat klasyczny i kwantowy



Świat klasyczny i kwantowy



Co to jest OPERATOR?

Rachunek zaburzeń Pole magnetyczne, sprzężenie spin orbita, J, L, S



Pole elektryczne



http://www.tutorvista.com/content/chemistry/chemistry-iv/coordination-compounds/crystal-field-splitting.php

Co to jest spin?







Sebastian Münster, Cosmographia in 1544



Disney

Dipolowe przejścia optyczne. Reguły wyboru, czas życia



"You want proof? I'll give you proof!"

PODSUMOWANIE – złota reguła Fermiego

Prawdopodobieństwo przejścia na jednostkę czasu:

$$W(t) = W$$

$$0 \le t \le \tau$$

$$P_{mn} = \frac{w_{mn}}{\tau} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle m|W|n \rangle|^2 \delta(E_m - E_n)$$

Przejścia są możliwe tylko do stanów $E_m = E_n$

$$W(t) = w^{\pm} e^{\pm i\omega t}$$

$$0 \le t \le \tau$$

$$P_{nm} = \frac{w_{nm}}{\tau} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle n|w^{\pm}|m\rangle|^{2} \delta(E_{n} - E_{m} \pm \hbar\omega)$$

Przejścia są możliwe tylko do stanów $E_m = E_n \pm \hbar \omega$

Zaburzenie w postaci fali elektromagnetycznej.

$$A_{nm} = \frac{\omega_{nm}^3 e^2}{3\pi\varepsilon_0 \hbar c^3} |\langle m|\vec{r}|n\rangle|^2 = \frac{4\alpha}{3} \frac{\omega_{nm}^3}{c^2} |\langle m|\vec{r}|n\rangle|^2$$

$$P_{nm} = A_{nm}\delta(E_n - E_m \pm \hbar\omega)$$

7

Wyprowadzenie prawa Plancka.



"BUT THIS IS THE SIMPLIFIED VERSION FOR THE GENERAL PUBLIC."

S. Harris

Lasery

Laser potrzebuje co najmniej 3ch stanów



Fala elektromagnetyczna

Zaburzenie w postaci fali elektromagnetycznej.

$$A_{nm} = \frac{\omega_{nm}^3 e^2}{3\pi\varepsilon_0 \hbar c^3} |\langle m|\vec{r}|n\rangle|^2 = \frac{4\alpha}{3} \frac{\omega_{nm}^3}{c^2} |\langle m|\vec{r}|n\rangle|^2$$

W przypadku degeneracji stanów wprowadza się "siłę linii"

$$A_{nm} = \frac{4\alpha}{3} \frac{\omega_{nm}^3}{c^2} \frac{S_{mn}}{g_m} \qquad S_{nm} = \sum_i \sum_j |\langle n_i | \vec{r} | m_j \rangle|^2$$

degeneracja poziomu wyjściowego

W przypadku stanów atomu wodoru wygodnie jest przedstawić operator \vec{r} w postaci kołowej:

$$|\langle n_i | \vec{r} | m_j \rangle|^2 = |\langle n_i | z | m_j \rangle|^2 + \frac{1}{2} |\langle n_i | x + iy | m_j \rangle|^2 + \frac{1}{2} |\langle n_i | x - iy | m_j \rangle|^2$$

łatwo jest wtedy całkować harmoniki sferyczne, bo:

$$z = r \cos \vartheta$$
$$x \pm iy = re^{\pm i\varphi} \sin \vartheta$$



Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT

Optyka - powtórzenie

- Propagacja fali elektromagnetycznej.
- Natężenie fali.
- Oddziaływanie fali e-m z ośrodkiem,
- Odbicie plazmowe,
- klasyczny współczynnik załamania,
- kształt linii widmowych, poszerzenia.



Optyka - powtórzenie

Fala elektromagnetyczna w próżni	Fala elektromagnetyczna w dielektryku					
Równania Maxwella:	Równania Maxwella:					
$\nabla \times \vec{E} = rot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\nabla \times \vec{E} = rot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$					
$\nabla \times \vec{B} = rot\vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E}{\partial t}$	$\nabla \times \vec{B} = rot\vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \mu \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$					
Ale w jaki sposób ośrodek oddziałuje z falą						
elektromagnetyczną? Czy ε (a więc n) jest stałe?						
$\Delta \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\varepsilon^2}{\partial t^2}$	$\Delta \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \mu \varepsilon \frac{\sigma^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}$					
Prędkość fali elektromagnetycznej:	Prędkość fali elektromagnetycznej:					
$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	$\upsilon = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \mu \varepsilon}} = \frac{c}{n}$					
Współczynnik załamania:	Współczynnik załamania:					
$n = 1 \qquad \qquad k = \frac{\omega}{c}$	$n = \frac{c}{\upsilon} = \sqrt{\mu\varepsilon} \qquad k = \frac{n\omega}{c}$					

Klasyczny model współczynnika załamania

Fala w ośrodku (różnym):



Rozwiązanie dla stanu ustalonego typu:

$$\vec{x} = \vec{x}_0 e^{i\omega t}$$

Klasyczny model współczynnika załamania

Zjawisko Mossbauera



The Nobel Prize in Physics 1961

"Explain it! The most important thing is, that you are able to explain it! You will have exams, there you have to explain it. Eventually, you pass them, you get your diploma and you think, that's it! – No, the whole life is an exam, you'll have to write applications, you'll have to discuss with peers... So learn to explain it! You can train this by explaining to another student, a colleague. If they are not available, explain it to your mother – or to your cat!"



Rudolf Ludwig Mössbauer ur. 1929

Za Wikipedią



Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT

Wiązania chemiczne i cząsteczki

- Orbitale atomowe
 - *n* energia
 - *l* moment pędu
 - *s* spin
- Rydberg: 13,6 eV



"What do you expect, since 90% of all the scientists who ever lived are alive today?"

Cząsteczki

Hamiltonian wieloelektronowy

$$\hat{H}(\vec{r},\vec{R})\Psi(\vec{r},\vec{R}) = E\Psi(\vec{r},\vec{R})$$

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{T}_N + V(\vec{r}, \vec{R})$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{i} \nabla_i^2 - \sum_{N} \frac{\hbar^2}{2M_N} \nabla_N^2 - \sum_{N,K-\text{ atomy}} \frac{i,j-\text{elektrony}}{N,K-\text{ atomy}}$$
$$-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{N,i} \frac{Z_N e^2}{\left|\vec{r}_i - \vec{R}_N\right|} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{N< K} \frac{Z_N Z_K e^2}{\left|\vec{R}_N - \vec{R}_K\right|} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i< j} \frac{e^2}{\left|\vec{r}_i - \vec{r}_j\right|}$$

Cząsteczki



Przejścia optyczne w cząsteczkach





Podziękowania za pomoc w przygotowaniu zajęć: Prof. dr hab. Paweł Kowalczyk Prof. dr hab. Dariusz Wasik

Uniwersytet Warszawski

Cząsteczki

Hybrydyzacja sp i całki przykrycia



http://www.chemistry.mcmaster.ca/esam/Chapter_6/section_4.html

Cząsteczki

Hybrydyzacja i całki przykrycia

Kąty między wiązaniami wodoru wynoszą 109,5°. Hybrydyzacja sp³

$$h_{1} = \frac{1}{2}(s + p_{x} + p_{y} + p_{z})$$

$$h_{2} = \frac{1}{2}(s + p_{x} - p_{y} - p_{z})$$

$$h_{3} = \frac{1}{2}(s - p_{x} + p_{y} - p_{z})$$

$$h_{4} = \frac{1}{2}(s - p_{x} - p_{y} + p_{z})$$



Materia skondensowana



Podziękowania za pomoc w przygotowaniu zajęć: Prof. dr hab. Paweł Kowalczyk Prof. dr hab. Dariusz Wasik

Uniwersytet Warszawski

Rodzaje wiązań

Wiązanie jonowe

Elektroujemność (ozn. χ) - zdolność atomu w cząsteczce do przyciągania (przyłączania) elektronu. W skrajnym przypadku, gdy elektroujemności obu pierwiastków bardzo się różnią (np. Li i F), dochodzi do pełnego przeskoku elektronów na bardziej elektroujemny atom, co prowadzi do powstania wiązania jonowego ($\Delta \chi \geq 1,7$).



Tablica 2.4. Wartości elektroujemności (wg Paulinga) dla kilku ważniejszych pierwiastków (dla H przyjęto 2,1)

1	П	III	IV	V		VI	VII
Li	Ве	В	С	Ν		0	F
1,0	1,5	2,0	2,5	3,	0	3,5	4,0
Na	Mg	AI	Si	Ρ		S	Cl
0,9	1,2	1,5	1,8	2,	1	2,5	3,0
К	Са	Ga	Ge	As	5	Se	Br
0,8	1,0	1,6	1,7	2,	0	2,4	2,8
Rb			Sn				J
0,8			1,7				2,4
			Jono	vość			

Struktura krystaliczna

Sieci Bravais

Przykład: struktura najgęstszego upakowania



Krystalografia



Dla małych kątów rozproszeń $\Delta k \xi \rightarrow 0$ f = -Z

Atomowy czynnik rozpraszania *f* oznacza stosunek amplitudy promieniowania rozproszonego przez **rzeczywisty rozkład elektronów** w atomie do amplitudy promieniowania rozproszonego przez **jeden elektron punktowy**.

Studia li stopnia IN



Studia II stopnia na makrokierunku **"Inżynieria nanostruktur"** odbywają się w ramach trzech ścieżek kształcenia:

- Fotonika (Photonics),
- Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR) (Modeling of Nanostructures and Novel Materials), Nanotechnologie
- Charakteryzacja Nowych Materiałów (NiChNM) (Nanotechnologies and the Characterization of Novel Materials).

Studenci mają do wyboru zajęcia profilowane na zdobycie specjalistycznego wykształcenia związanego z nanotechnologiami, zagadnieniami będącymi aktualnymi problemami naukowymi i realizacji programu studiów II stopnia we współpracy z grupami badawczymi.
Studia li stopnia IN



Po pierwszym semestrze II etapu studiów, studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia. W tym celu muszą udać się do opiekuna danej ścieżki, który przedstawi możliwości wykonywania prac magisterskich oraz ich opiekunów. Opiekun będzie ustalał z każdym studentem indywidualny program studiów w zakresie wybieranych przedmiotów



Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

- Stypenida 1000 zł/mies
- Wyjazdy na dowolne konferencje w Europie
- Zajęcia dokształcające i warsztaty naukowe
- Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Elektrony w kryształach – funkcja Blocha, pasma.

Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT







S.

Podstawy modelu jednoelektronowego

Twierdzenie Blocha

Wartości własne energii są periodyczną funkcją liczby kwantowej k. $\vec{G} = h\vec{g}_1 + k\vec{g}_2 + l\vec{g}_3$ $E(n,\vec{k}) = E(n,\vec{k}+\vec{G})$ $g_i = \frac{2\pi}{a_i}$

Model prawie swobodnych elektronów – dla fali płaskiej w pustej przestrzeni energia od wektora falowego wyraża się wzorem:



Elektrony i dziury.

Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT







Uniwersytet Warszawski

Podstawy modelu jednoelektronowego

Twierdzenie Blocha

Jeśli potencjał jest periodyczny $V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R})$ to rozwiązania równania Schrodingera

$$\begin{pmatrix} \frac{\vec{p}^2}{2m_0} + V(\vec{r}) \\ \Psi(\vec{r}) = E \Psi(\vec{r}) \\ \Psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\vec{r}} u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

gdzie tzw. f. Blocha: $u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n,\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R})$

$$\psi_{n,\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r}) = \psi_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$
$$E(n,\vec{k}) = E(n,\vec{k}+\vec{G})$$

$$\hat{p}\psi(\vec{r}) = -i\hbar(i\vec{k} + \nabla u_{n,\vec{k}})e^{i\vec{k}\vec{r}} \neq \hbar k\psi(\vec{r})$$



"You want proof? I'll give you proof!"

Elektrony i dziury

Kwazicząstki - dziury

Dla opisania sumarycznych właściwości tych 2N-1 elektronów wprowadzamy pojęcie nowej kwazicząstki -dziury. Dziura quasi cząstka z dodatnią masą efektywną, która opisuje własności zbioru elektronów w ciele stałym o masie ujemnej z jednym stanem pustym.



Pole elektryczne E

 $\vec{j} = -e\vec{v}_{e-bez-pary}$ $\vec{j} = +e\vec{v}_{e-w-pustym-miejscu}$ $\vec{v}_h = \vec{v}_{e-w-pustym-miejscu}$

Półprzewodniki (ang. semiconductors).



Uniwersytet Warszawski

Funkcja rozkładu

Rozkład Fermiego-Diraca



Elektrony i dziury

Gęstość stanów

Często wygodniejsza jest znajomość gęstości stanów w przestrzeni energii E (a więc ilość stanów w przedziale (E, E+d E). Dla pasma sferycznego i parabolicznego:

